(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月6日(06.07.2023)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2023/127553 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2022/046444

(22) 国際出願日： 2022年12月16日(16.12.2022)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

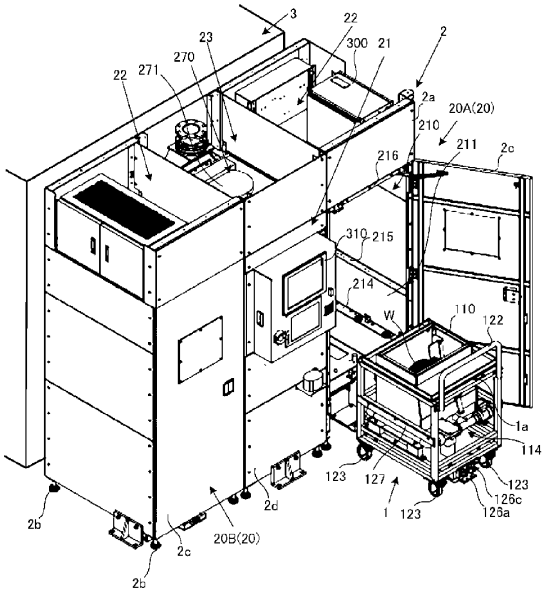
(30) 優先権データ：
特願 2021-214779 2021年12月28日(28.12.2021) JP

(71) 出願人: 芝浦メカトロニクス株式会社 (**SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION**) [JP/JP]; 〒2478610 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号 Kanagawa (JP).

(72) 発明者: 新井 理恵 (**ARAI Rie**); 〒2478610 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号 芝浦メカトロニクス株式会社内 Kanagawa (JP). 西部 幸伸 (**NISHIBE Yukinobu**); 〒2478610 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号 芝浦メカトロニクス株式会社内 Kanagawa (JP). 加藤 峻 (**KATO Shun**); 〒2478610 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号 芝浦メカトロニクス株式会社内 Kanagawa (JP). 二ツ川 進治 (**FUTATSUKAWA Shinji**); 〒2478610 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号 芝浦メカトロニクス株式会社内 Kanagawa (JP).

(54) **Title:** SUBSTRATE TRANSFER DEVICE AND SUBSTRATE TRANSFER METHOD

(54) 発明の名称： 基板受渡装置及び基板受渡方法



(57) **Abstract:** Provided are a substrate transfer device and a substrate transfer method that make it possible to transport a substrate between processing devices while maintaining the surface of the substrate in a wet state. A substrate transfer device 2 according to one embodiment includes: a carriage accommodating part 210 having an accommodating chamber 211 which receives a substrate conveyance carrier 1 from outside the device and accommodates such carrier, the substrate conveyance carrier having mounted thereon a tank 110 accommodating a plurality of substrates W together with water; and

WO 2023/127553 A1

［続葉有］

(74) 代理人：木 内　光 春，外 (**KIUCHI Mitsuharu** et al.)；〒1050003 東京都港区西新橋１丁目６番１３号 虎ノ門吉荒ビルディング５階 Tokyo (JP).

(81) 指定国（表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能）：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

an extraction device 250 that extracts the substrates W from the tank 110 mounted on the substrate conveyance carrier 1 accommodated in the accommodating chamber 211, and delivers the substrates to a cleaning device 3 which is an adjacent treatment device.

(57) 要約：基板の表面が濡れた状態を維持しつつ、処理装置間で基板を搬送できる基板受渡装置及び基板受渡方法を提供する。実施形態の基板受渡装置２は、複数の基板Ｗを水とともに収容したタンク１１０を搭載した基板搬送用台車１を、外部から受け入れて収容する収容室２１１を有する台車収容部２１０と、収容室２１１内に収容された基板搬送用台車１に搭載されたタンク１１０から、基板Ｗを取り出して、隣接する処理装置である洗浄装置３に渡す取出装置２５０と、を有する。